

表 4.6.2 臺灣 2001 至 2017 年積體電路或半導體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
HFC	51	59	59	59	73	91	171	118	168
PFC	2,993	4,078	4,174	4,327	3,043	3,211	2,933	1,657	1,126
SF ₆	524	499	513	587	587	695	292	229	198
N ₂ O	NE	NE	NE	NE	NE	342	389	360	333
NF ₃	202	359	455	587	623	512	590	136	198
總計	3,711	4,994	5,199	5,559	4,237	4,850	4,375	2,500	2,298
年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
HFC	164	134	86	169	182	132	156	163	
PFC	1,322	1,202	692	899	1,272	917	1,030	968	
SF ₆	239	261	181	213	312	224	217	201	
N ₂ O	482	466	558	626	685	714	682	727	
NF ₃	156	306	295	687	531	562	387	326	
總計	2,363	2,502	1,812	2,595	2,823	2,549	2,472	2,385	

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。早期積體電路或半導體未大量生產，故無追溯調查 1990 至 2000 年排放量。另，N₂O 尚無 IPCC 公告之製程耗用率及管末處理削減率，故迄今 TSIA 採用保守原則使用量 100% 全部排放申報，世界半導體協會已經開始討論其合宜性，將待其有結論之後配合之。